## Si 上 GalnAs/InP p-i-n 薄膜光検出器の感度特性の評価

Membrane-based GaInAs/InP p-i-n photodiode fabricated on Si substrate 東京工業大学,工学院電気電子系<sup>1</sup> 科学技術創成研究院<sup>2</sup>

> <sup>0</sup>顧 之琛<sup>1</sup>、瓜生 達也<sup>1</sup>、中村 なぎさ<sup>1</sup>、井上 大輔<sup>1</sup>、雨宮 智宏<sup>1,2</sup> 西山 伸彦<sup>1,2</sup>、荒井 滋久<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Dept. of Electrical and Electronic Engineering, <sup>2</sup> Institute of Innovation Research (IIR), Tokyo Institute of Technology

°Zhichen Gu<sup>1</sup>, Tatsuya Uryu<sup>1</sup>, Nakamura Nagisa<sup>1</sup>, Daisuke Inoue<sup>1</sup>, Tomohiro Amemiya<sup>1,2</sup> Nobuhiko Nishiyama<sup>1,2</sup>, and Shigehisa Arai<sup>1,2</sup>

E-mail: gu.z.ab@m.titech.ac.jp

## はじめに

近年の LSI 内素子の微細化に伴う問題の解決 策として、光配線が注目されている。そこで我々 は、半導体薄膜光集積回路を LSI 上にハイブリッ ド実装する技術を提案しており、光源をはじめと した一連の光素子の研究を行っている[1-3]。中で も、光検出器は、回路全体の性能を律速する要因 にもなっており、小型・高速・高感度化を同時に 実現するような構造が強く望まれている。

今回、Si 上集積型 GalnAs バルク吸収層薄膜 p-i-n フォトダイオード(PD)を試作し、その感 度特性の評価を行ったのでご報告する。

## <u>結果</u>

集積型薄膜 GalnAs/InP-PD の構造を Fig. 1 に 示す。吸収層として GalnAs バルク(厚み 120 nm) を用いており、その両側に p- と n-InP を形成し た横方向電流取り出し型 p-i-n 構造となっている。 実験においては、異なる吸収長 Lとストライプ幅 Ws を有する素子を作製し、バットジョイントさ れた GalnAsP 細線導波路から光を入射すること で感度測定を行った。吸収長 30 µm、ストライプ 幅 0.7 µm の素子における光電流特性を Fig. 2 に 示す。有限差分法を用いた理論解析から求まる入 カ光ファイバと導波路の結合効率(20%)を考慮 すると、PD 単体の感度は 0.95 A/W であると見 積られた。

Fig. 3 に、異なる L と W<sub>8</sub> に対する感度の実験 値および理論曲線(GalnAs の吸収係数は 5000 cm<sup>-1</sup> と仮定)を示す。ストライプ幅 0.7 μm の素 子においては、10 μm の素子長で 90%以上の光 吸収が得られることが分かった。今後は、フォト ニック結晶構造によるスローライト効果を用い て、素子の短縮化による高速動作を目指す[4] [5]。

<u>謝辞</u>本研究は JSPS 科研費(#15H05763,#15J11776, #16H06082, #16J11581, #17H03247)および JST CREST PMJCR15N6の援助により行われた。

## <u>参考文献</u>

- [1] D. A. B. Miller, Proc. IEEE. **97** (2009) 1166.
- [2] T. Shindo et al., Jpn. J. Appl. Phys. 52 (2013) 118002.
- [3] D. Inoue *et al.*, IEEE. J. Sel. Top. Quantum Electron. **21** (2015) 1502907.



Fig. 1 Schematics of GalnAs/InP p-i-n membrane PD bonded on Si substrate.



Fig. 2 Photocurrent against independent power at 1550 nm with different bias voltage.



Fig. 3 Experiment plots and theoretical curve of  $R_{ex}$  against absorption region length at 1550 nm with different stripe width  $W_{s}$ .

- [4] K. Nozaki et al., Optica 3 (2016) 483.
- [5] Z. Gu *et al.*, JOSA B **34** (2017) 440.